

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มนาโนไททาเนียมไดออกไซด์และคาร์บอน
คล้ำยเพชรที่สร้างด้วยเทคนิคอาร์คแคโทดแบบกรองในสุญญากาศ

ผู้เขียน นายชาญวิชัย อร่ามวิทย์

ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผศ. ดร. อุดมรัตน์ ทิววรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ดร. ยู เหลียงเต็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ดร. เสวต อินทศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

ฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์และฟิล์มคาร์บอนคล้ำยเพชรได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยเทคนิคการอาร์คแคโทดแบบกรองในสุญญากาศภายใต้เงื่อนไขในการสังเคราะห์ฟิล์มที่หลากหลายเพื่อทำการปรับปรุงคุณลักษณะของฟิล์ม ได้แก่ ความดันของแก๊สออกซิเจน, ศักย์ไบแอส, ระยะเวลาในการเคลือบ และการอบสำหรับฟิล์มไททาเนียม ในขณะที่เงื่อนไขในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ำยเพชร ได้แก่ ค่าศักย์ไบแอสและความดันของแก๊สไนโตรเจน พบว่าการเคลือบฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ภายใต้ความดันแก๊สออกซิเจนที่ 10^{-3} ทอร์ และศักย์ไบแอส 0 โวลต์ ฟิล์มจะมีความหนาแน่นต่ำที่สุด อย่างไรก็ตามฟิล์มที่ไม่ได้ทำการอบจะไม่ได้แสดงคุณสมบัติโฟโตคาตาไลซิสในการต่อต้านแบคทีเรีย เพราะการอบฟิล์มช่วยเพิ่มการจับตัวเป็น โครงสร้างแอนาเทส แต่ฟิล์มที่เคลือบ 30 นาทีเมื่อผ่านการอบจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงกำลังแสงที่ 0.0249 % ด้วยความหนา 80 นาโนเมตร อย่างไรก็ตามการเพิ่มระยะเวลาการเคลือบให้มากขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มได้ นอกจากนี้ฟิล์มคาร์บอนคล้ำยเพชรที่สังเคราะห์ด้วยศักย์ไบแอส -250 โวลต์จะมีอัตราส่วนของโครงสร้าง sp^3 ต่อ sp^2 สูงที่สุด ในขณะที่การเติมแก๊สไนโตรเจนจะช่วยเพิ่มแรงยึดติดของฟิล์มแต่จะลดความแข็งของฟิล์มลง

Thesis Title Characterizations of Titanium Dioxide and Diamond-Like Carbon Nanocoating Film Formed by Filtered Cathodic Vacuum Arc Deposition Technique

Author Mr. Chanwit Aramwit

Degree Master of Science (Physics)

Advisory Committee Asst. Prof. Dr. Udomrat Tippawan Advisor

Dr. Liang Deng Yu Co-advisor

Dr. Saweat Intarasiri Co-advisor

ABSTRACT

Titanium dioxide (TiO₂) films and Diamond-like Carbon (DLC) film were synthesized using Filtered Cathodic Vacuum Arc Deposition (FCVAD) technique. Various deposition conditions were tested for an optimal film formation; the various oxygen (O₂) pressures, bias voltage, deposition time and annealing for TiO₂ film, while the various biased voltage and nitrogen (N₂) pressures for DLC film. The TiO₂ deposited with O₂ pressure at 10⁻³ torr with 0 V biasing provides the lowest density of the TiO₂ film. However, the TiO₂ films do not show their photocatalytic properties as an antibacterial agent without annealing because the annealing boosts forming up the anatase structure, whereas the film with not less than 20 minutes deposition time causes the power conversion efficiency as 0.0249 % with its thickness 80 nm, however increasing of the deposition time can improve the efficiency. In additions, the DLC are deposited with -250 V causes highest sp³/sp² structure, while the addition of the N₂ gas improves the DLC films' adhesion but cost their hardness.